文章编号:1672-3961(2008)06-0082-05

Ga 掺杂 ZnO 纳米粉体的合成及其光、电学性能研究

徐润春,吕伟*,徐青

(山东大学化学与化工学院,山东 济南 250100)

摘要:利用简单的溶剂热法,在具有不同镓浓度的锌前驱体溶液中得到了 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉体.采用 X 射线光电 子能谱仪(XPS)、X-射线衍射仪(XRD)、透射电镜(TEM)、荧光光谱仪(PL)及霍尔效应测试(HES)等研究手段分别 对样品的成分、形貌及光、电性能进行了研究.分析了前驱体溶液中镓浓度对产物光、电学性能的影响. 关键词:Ga 掺杂 ZnO;纳米粉体;光致发光;霍尔效应 中图分类号:TQ132.4+1 文献标志码:A

Study of the synthesis and optical and electrical properties of Ga-doped ZnO nanopowders

XU Run-chun, LÜ Wei*, XU Qing

(School of Chemistry and Chemical Engineering, Shandong University, Jinan 250100, China)

Abstract: Ga-doped ZnO nanopowders were obtained from zinc precursor solutions with different Ga concentrations via a simple solvo-thermal route. The optical and electrical properties of the obtained nanopowders have been investigated by XRD, TEM, XPS, PL and Hall effect measurement system (HES). The influence of Ga concentration in zinc precursor solutions on the optical and electrical properties of the product was investigated.

Key words: Ga-doped ZnO; nanopowders; photoluminescence; Hall effect

0 引言

氧化锌(ZnO)作为一种半导体材料,室温下其 带隙宽为3.37 eV,激子束缚能高达60 meV,这使其 具备了优良的光学、电学性能,并被广泛应用于光学 器件和电学器件领域^[1].目前,ZnO 在透明导电材料 和压电材料方面的应用研究得到了普遍关注,研究 的热点主要体现在光电池,平板显示器,电极,图像 传感器及电致变色窗口等方面^[2].另外,由于 ZnO 材料具有低毒性、低成本、高反应活性等特点,使得 其作为光催化剂降解环境污染物的研究也得到了广 泛重视^[3].在紫外发射二极管(LED)和激光二极管 (LD)等短波光电器件领域内,ZnO 一直被公认是最 佳的候选材料之一.这也是目前氧化锌的光学,电学 性能成为相关研究人员关注热点的原因之一.

2008年12月

Dec. 2008

近年来,为改善 ZnO 的光学、电学性能,科研人员采用不同的方法对其进行了掺杂研究^[4-6].一般多采用第 Ш 族(如:Al, Ga, In 等)作为掺杂剂来提高ZnO 的电学性质^[2,4-6].其中,Ga 被认为是一种有效的 n 型掺杂剂.由于 Ga—O 键键长(0.192 nm)接近Zn—O 键键长(1.97 nm),并且 Zn²⁺与 Ga³⁺ 半径几乎相同(*R*(Zn²⁺)≈0.074 nm,*R*(Ga³⁺)≈0.062 nm).所以,Ga 掺杂不会引起大的晶格变形^[7].由此,关于 Ga 掺杂 ZnO 的研究多集中在薄膜的制备及其性能研究方面^{[5][8]},对 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉体的制备及其 性能研究的报道较少.本实验采用简单的低温溶剂

收稿日期:2008-10-13

基金项目:山东省优秀中青年科学家奖励基金资助项目(2006BS04008)

作者简介:徐润春(1976-),女,黑龙江五常人,硕士研究生,主要从事无机纳米材料合成与性质研究.

E-mail: xrunchun_2006@163.com

^{*}通讯作者:吕伟(1965-),男,山东成武人,副教授,博士,主要从事无机功能纳米材料合成与性质研究. E-mail:lwei@sdu.edu.en

热方法合成了 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉体,并研究了前驱体溶液中镓浓度对氧化锌光学、电学性能的影响.

1 实验过程

1.1 样品制备

本实验所用试剂均为分析纯.实验制得的未掺 杂 ZnO 为白色粉末, Ga 掺杂 ZnO 为青绿色粉末.且 随着前驱体溶液中 Ga 浓度的增加,粉末颜色逐渐 变深.实验步骤如下:(1)分别称取适量的 Ga,O,粉 末,将其加入盛有 NaOH 溶液的 50 mL 聚四氟乙烯 反应釜中(注: $n(Ga^{3+}):n(OH^{-})=1:20$),然后将反 应釜放入不锈钢衬套中密封,置于80℃的烘箱中, 反应 2 h,得到透明的 NaGaO₂ 溶液($0.005 \text{ mol} \cdot L^{-1}$, $0.01 \text{ mol} \cdot L^{-1}$, $0.025 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ and $0.04 \text{ mol} \cdot L^{-1}$). (2) 将 10 g NaOH 和 5.5 g Zn(CH₃COO)₂·2H₂O 先后 加入 50 mL 蒸馏水中,充分搅拌后,得到白色悬浊液 (前驱体). (3) 分别将 1 mL 前驱体、39 mL 乙醇、 5 mL乙二胺 (C₂H₈N₂)加入聚四氟乙烯反应釜中,得 到前驱体溶液.该溶液在水浴槽中超声混合 10 min 后,测得 pH = 13.1.然后,将经超声处理的前驱体溶 液移入聚四氟乙烯反应釜内,密封后置于140℃烘 箱中,反应24h,用自来水冷却至室温.反应液经离 心、蒸馏水洗涤、乙醇洗涤后,于60℃干燥8h、得到 白色氧化锌纳米粉末.对于 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉末 的前驱体溶液(溶液中 Ga 与 Zn 的摩尔分数分别为 1%, 2%, 5%, 8%), 在加入 C₂H₈N₂ 之前, 分别向 不同的反应釜内加入1mL NaGaO,溶液,其他过程

与制备未掺杂氧化锌粉末相同.

1.2 样品表征

样品的物相分析是在 Bruker D8-advance X 射线 衍射仪(XRD)上进行,辐射源为 Cu Kα(λ = 0.154 06 nm),衍射角范围是 20 ~ 70°.利用 JEM-100CX II 透射电镜对纳米粉体的形貌进行观察.样 品的表面成分分析在 PHI5300型 X 射线光电子能谱 仪(XPS)上进行.样品的室温光致发光(PL)性能测 试在 970CRT 荧光光谱仪上进行.使用 Xe 灯为激发 光源,激发波长为 325 nm.样品的室温电学特性数据 在 HES-3000 霍尔效应仪上测得.测量之前,首先,在 压力约为 10 atm 下,将粉末样品压成厚度约为 2 mm 的薄膜.然后,利用范德堡法在霍尔效应测试仪上测 得样品的载流子浓度、迁移率和电阻率.

2 结果与讨论

2.1 结构与形貌分析

图 1 为锌前驱体溶液中 Ga、Zn 摩尔分数分别为 1%和 5%样品的 XPS 谱.对图 1(a)、(b)中所有峰进 行标定的结果表明:除 Zn 和 O 元素的强峰外,均能 观察到一个与 Ga 2p_{3/2}能级对应的较弱的峰.这表示 样品表面存在 Zn、O 和 Ga 元素.图 1(a)和(b)中插 图是 XPS 图中 Ga 2p_{3/2}峰放大和平滑处理后的结果. 由图可知,图 1(a) 插图中 Ga 2p_{3/2}峰位在 1 118.2 eV 处,图 1(b)插图中 Ga 2p_{3/2}峰位在 1 115.9 eV 处,这 与 Ga—O 键的结合能在 1 117 eV 附近^[9]相吻合.由 此说明:在样品的表面 Ga 元素以离子态存在.这表 明 Ga 离子代替 Zn 的位置成功掺杂进入 ZnO 粉末.



图 1 锌前驱体溶液中 Ga:Zn 摩尔比分别为 1%(a)和 5 mol%(b)样品的 X 射线光电子能谱 Fig.1 XPS spectrum of the sample from 1%(a) and 5 mol%(b) (Ga:Zn) Zinc precursor solutions

图 2 为 ZnO 与不同镓摩尔分数(1%, 2%, 5%, 8%)前驱体溶液中所得 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉体的

XRD 谱. 对图 2 中所有衍射峰进行标定的结果表明:所有样品均体现六方纤锌矿的氧化锌结构(JCP-

DS: 36-1451),无 Ga_2O_3 , $NaGaO_2$ 等含镓化合物的特 征峰存在.这表明 Ga^{3+} 可能替代 ZnO 晶格中的 Zn 的位置或占据了 ZnO 的晶格间隙,而过量的镓可能 被隔离到晶粒边界的非晶区形成 Ga-O 键^[8].



图 2 未掺杂与 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉末的 X-射线衍射图 Fig.2 X-ray diffraction patterns of the undoped and Ga doped ZnO nanopowders

为研究溶液中 Ga 摩尔分数对样品晶态及形貌 的影响,对样品形貌进行 TEM 观察.根据图 3(a)、 (b)、(c)和(d)可知:当溶液中 Ga 摩尔分数为 0%、 1%、2%、5%时,随着 Ga 摩尔分数的增加,纳米粒子 的长度逐渐变短,而直径几乎无变化,长径比从20 减小到 2.图 3(a)所示为未掺杂 ZnO 纳米棒,其长度 约为 700~1 500 nm, 直径约为 30~70 nm. ZnO 纳米 棒的选区电子衍射(SAED)花样(见插图)说明 ZnO 纳米棒为单晶. 当溶液中 Ga 摩尔分数分别为 1% 和 2%时(见图 3(b)和(c)),样品的形貌仍为一维纳米 棒. 当溶液中 Ga 摩尔分数为 5% 时(见图 3(d)),纳 米粒子长度继续变短,接近于零维球状或零维六方 棱状结构.类似实验现象也出现在 Al 掺杂 ZnO^[10]和 Er 掺杂 TiO^[11]的研究中.研究认为纳米粒子形貌的 变化与溶液中 GaO5 浓度有关,随着溶液中 GaO5 浓度增加,吸附于晶粒表面 GaO⁵ 增多,这些 GaO⁵ 通过阻止晶粒边界运动抑制其沿[001]方向生长,导 致纳米粒子逐渐变短,而在本实验中,以上结论不适 合溶液中 Ga 摩尔分数为 8% 的样品(见图 3(e)).图 3(e)表明:该样品形貌为花状.这种纳米花的形成可 归因于 Ostwald 熟化作用,即表面自由能降低的过 程.如前所述,随溶液中掺杂剂浓度增加,纳米粒子 表面的 GaO⁻ 增多,同时粒子表面自由能提高.当表 面能达到某一临界值时,小粒子开始接触、合并以降 低表面能.最终形成大的纳米花.此外,从样品的 SAED 图(见图 3 插图)可以看出:随着溶液中 Ga 浓 度改变,样品的晶态发生变化.当溶液中 Ga 摩尔分 数从0%增加到5%时,样品的结晶状态由完美的单 晶转变为多晶. 而溶液中 Ga 摩尔分数为 8% 时,样 品又体现出完美的单晶结构.



图 3 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉末的透射电镜图片 前躯体溶液中 Ga 摩尔分数分别为:(a) 0%,(b) 1%,(c) 2%,(d) 5%,(e) 8% Fig.3 TEM images of Ga-doped ZnO nanopowders (a) 0%,(b) 1%,(c) 2%,(d) 5%,(e) 8% Ga:Zn in precursor solutions

2.2 光学性质

图 4 为 ZnO 与不同镓摩尔分数(1%, 2%, 5% 和 8%)前驱体溶液中所得 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉体的 室温 PL 谱. 从图 4 可以看出: 所有样品的 PL 谱中均 出现两个宽峰,一个是强近带边发射(NBE)峰,其波 长范围从近紫外区(~375 nm)到整个紫光区.另一 个为弱蓝光-靛光发射,峰值约在466 nm处.其中, NBE 峰产生于氧化锌自由激子的重结合,而这种重 结合是通过激子 - 激子碰撞过程实现的^[3]. 蓝光 -靛光发射是由氧化锌能带形成过程中产生的氧空位 缺陷引起的^[12].随着溶液中 Ga 浓度的增长,蓝光-靛光发射峰峰位无明显变化,这说明 Ga 在掺杂过 程中只替代或占据 ZnO 晶格中 Zn 位置,未填补到 氧空位缺陷处.因而,Ga 掺杂浓度未对氧空位引起 的缺陷能级产生影响.对于 NBE 峰, 当溶液中 Ga 浓 度低于5%时,随着溶液中Ga浓度的增长,NBE峰 逐渐红移,而红移现象是由能级缺陷引起的^[3].研究 认为 Ga 掺杂过程导致了额外的氧化锌带隙缺陷能 级产生,这一缺陷能级的存在使得晶体场中电子跃 迁的带隙变窄,即 Ga 掺杂起到了诱导带隙重整 (BGR)的作用^[13]. 当溶液中 Ga 摩尔分数从 0% 增加 到 5%时,NBE 峰从 412.7 nm 红移至415.9 nm. 这表 明 Ga 掺杂浓度越大,额外的氧化锌带隙缺陷越多, 电子跃迁的带隙越窄,跃迁能级也越低,最终导致电 子的重结合能降低,NBE 峰逐渐红移,以上结论同 样不适用于溶液中 Ga 摩尔分数为 8% 的掺杂 ZnO, 相对于未掺杂氧化锌,该 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉体的 NBE 峰发生蓝移.这一激子带蓝移现象可能与该纳 米粉体的结晶状态有关,从图 2(e)插图可以看出: 样品为完美的六方纤锌矿单晶结构,这说明晶体中 无明显的缺陷能级存在,且 Ostwald 熟化过程可能使 其结晶状态优于未掺杂氧化锌样品,因而,导致蓝移 发生.

2.3 电学性质

图 5 为 ZnO 与不同镓摩尔分数(1%, 2%, 5%和 8%)前驱体溶液中所得 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉体的电学 特性图.未掺杂 ZnO 的电阻率(ρ)为 1.93 × 10³ Ωm、 电子迁移率(μ)为 13.17 cm²·v⁻¹·s⁻¹,载流子浓度 (n)为 3.07 × 10¹¹ cm⁻³.当溶液中 Ga 摩尔分数为 1%、2%、5%时,样品的电阻率分别下降至2.04 Ωm, 0.656 Ωm 和 0.234 Ωm. 而载流子浓度分别增加至 9.18 × 10¹⁴ cm⁻³, 2.56 × 10¹⁵ cm⁻³和 6.20 × 10¹⁵ cm⁻³. 这表明:当溶液中 Ga 摩尔分数低于 5%时,随着 Ga 掺杂浓度的增加,载流子浓度增加,电阻率下降.但 当溶液中 Ga 摩尔分数为 8%时,载流子浓度减少至 3.26×10¹⁵ cm⁻³,这导致该样品的电阻率增大至 0.421 Ωm.这一现象可能与 Ga 在 ZnO 中的最大溶 解度为3.53%有关.从图 5 可以看出:当溶液中 Ga 摩尔分数低于 5%时,随 Ga 摩尔分数的增加,样品 的电子迁移率下降.但是当溶液中 Ga 摩尔分数为 8%时,样品的电子迁移率增加.这一结果可能与样 品的结晶状态有关^[14].由图 5 可知:少量 Ga 掺杂入 ZnO 就可明显改善其电学性质.



- 图 4 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉末的室温光致发光谱(图中 标示的数值为对应发射峰的峰值)
- Fig.4 PL spectra of the as-synthesized Ga-doped ZnO nanopowders measured at room temperature, the numerical values in the spectra denote the peak value of the corresponding curves





Fig. 5 Resistivity, carrier concentration and mobility as a function of Ga doping concentration in zinc precursor solutions

3 结论

(1) 通过简单的低温溶剂热路线,在不同镓浓

度的锌前驱体溶液中得到了具有六方纤锌矿结构 Ga 掺杂 ZnO 纳米粉体.

(2)当前躯体溶液中 Ga 摩尔分数为 0%、1%、 2%、5%时,随着 Ga 摩尔分数的增加,所得粉末样品 的直径(30~70 nm)几乎不变,长度逐渐减小,其形 貌由长径比约为 20 的一维纳米棒转变为长径比约 为 2 的近似球状或六方棱状零维纳米粒子,且样品 的结晶状态也由单晶逐渐转变为多晶.PL 谱分析表 明:由于 Ga 掺杂诱导了带隙重整,引起了 NBE 峰随 溶液中 Ga 摩尔分数的增加逐渐红移.样品的电学 特性分析显示,随着溶液中 Ga 掺杂浓度增加,载流 子浓度的增加,电阻率和电子迁移率逐渐下降.且本 试验中所得粉末样品的最佳电学性质为载流子浓度 6.20×10¹⁵ cm⁻³,电阻率为 0.234 Ωm.

参考文献:

- [1] 施利毅,马书蕊,冯欣,等.一维氧化锌纳米棒制备技术的最新研究进展[J].材料导报.2006(20):86-89.
 SHI Liyi, MA Shurui, FENG Xin, et al. The newest synthetic routes of one-dimensional ZnO nanorods[J]. Materials Review. 2006(20):86-89.
- [2] DUENOW J N, GESSER T A, WOOD D M, et al. Effects of hydrogen content in sputtering ambient on ZnO: Al electrical properties [J]. Journal of Non-Crystalline Solides, 2008, (354):2787-2790.
- [3] WU Li-li, WU You-shi, SHI Yuan-chang, et al. Synthesis of ZnO nanorods and their optical absorption in visible-light region
 [J]. RARE METALS, 2006, (25):68-73.
- [4] CHEN L L, YE Z Z, LUA J G, et al. Co-doping effects and electrical transport in In-N doped zinc oxide [J]. Chemical Physics Letters, 2006, (432):352-355.
- [5] 余旭浒,马瑾,计峰,等. 射频磁控溅射制备 ZnO:Ga 透明导电膜及特性[J]. 半导体学报, 2005, 26(2):314-318.
 YU Xu-hu, MA Jin, JI Feng, et al. Properties of transparent conducting ZnO:Ga films prepared by RF magnetron sputtering [J]. Chinese Journal of Semiconductors, 2005, 26(2):314-318.

- [6] AHN B D, OH S H, HONG D U, et al. Transparent Ga-doped zinc oxide-based window heaters fabricated by pulsed laser deposition[J]. Journal of Crystal Growth, 2008(310):3303-3307.
- [7] 乔彬,唐子龙,张中太,等. ZnGa₂O₄: Cr³⁺ 红色荧光粉的光致及电致发光性能[J].物理化学学报,2006,22(10):1291-1295.
 QIAO B, TANG Z L, ZHANG Z T, et al. Photoluminescent and electroluminescent characteristics of ZnGa₂O₄: Cr³⁺ red phosphor[J]. Acta Phys-Chim Sin, 2006, 22(10):1291-1295.
- [8] HERNG T S, LAU S P, YU S F, et al. Zn interstitial enhanced ferromagnetism in Cu-doped ZnO films[J]. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2007, (315):107-110.
- [9] JUN J H, CHO K, YUN J, et al. High quality p-type ZnO film grown by low pressure plasma-assisted MOCVD with N_2 O rf plasma doping source[J]. Organic Electronics, 2008, (9): 445.
- [10] SUWANBOON S, AMORNPITOKSUK P, HAIDOUX A, et al. Structural and optical properties of undoped and aluminium doped zinc oxide nanoparticles via precipitation method at low temperature[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2008 (462):335-339.
- [11] JEON S, BRAUN P V. Hydrothermal synthesis of Er-doped luminescent TiO_2 nanoparticles[J]. Chem Mater, 2003, 15: 1256-1263.
- [12] FU Rui-peng, WANG Wei, HAN Rong-jiang, et al. Preparation and characterization of γ-Fe₂O₃/ZnO composite particles [J]. Materials Letters, 2008, (62):4066-4068.
- [13] YE J D, GU S L, ZHU S M, et al. Gallium doping dependence of single-crystal n-type Zno grown by metal organic chemical vapor deposition [J]. Journal of Crystal Growth, 2005, (283):279-285.
- [14] KOBAYASHI K, KONDO Y, TOMITA Y, et al. Electrical and optical properties of ZnO films prepared by sputtering of ZnO targets containing AlN[J]. Applied Surface Science, 2007, (253):5035-5039.

(编辑:胡春霞)